

**БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОНОВ ЧЕРЕЗ
ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ СЛОИ GaAs В
ЭФФЕКТЕ МАГНИТОИНДУЦИРОВАННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ФОТОТОКА**

B.Л.Альперович, A.O.Минаев, A.C.Терехов

Обнаружена немонотонная зависимость магнитоиндукционного поверхностного фототока от магнитного поля, свидетельствующая о переносе баллистических фотоэлектронов через толстый ($d \sim 10$ мкм) эпитаксиальный слой n -GaAs и их рассеянии на границе с подложкой. Коэффициенты диффузности рассеяния электронов с энергией 30 мэВ на свободной поверхности эпитаксиального слоя $P_1 \approx 0,2$, на границе слой–подложка $P_2 \approx 0,7$.

Баллистические фототоки (БФТ), возникающие на этапе свободного движения фотоэлектронов от момента рождения светом до рассеяния по импульсу, позволяют исследовать баллистический перенос не только в субмикронных, но и в обычных макроструктурах. Особый интерес представляет изучение с помощью БФТ рассеяния на границах раздела в слоистых полупроводниковых структурах. В данной работе сообщается об обнаружении нового механизма БФТ, обусловленного оптическим выстраиванием¹ и диффузным рассеянием фотоэлектронов на границах эпитаксиального слоя^{2–4}. Экспериментально показано, что при длине свободного пробега по импульсу $\Lambda_p \gtrsim d$, фотоэлектроны пересекают слой в баллистическом режиме и теряют импульс на границе раздела с подложкой. Сравнение с расчетом позволило оценить коэффициент диффузности на границе n -CaAs – полуизолирующая подложка.

БФТ вдоль поверхности измерялся при нормальном падении света, в тангенциальном магнитном поле B , поворачивающем траектории оптически выстроенных электронов. При этом диффузное рассеяние на границах слоя приводит к асимметрии функции распределения и соответствующему фототоку. Направление оптического выстраивания задается вектором поляризации света e , поэтому фототок является поляризационно-зависимым⁴:

$$j \sim e(e[B \times n]), \quad (1)$$

где n – вектор нормали к поверхности. Близкий по природе БФТ, но без магнитного поля и при наклонном падении света, исследовался в работах^{2,3}. Следует отметить, что для возникновения обнаруженного здесь фототока вдоль слоя достаточно диффузного рассеяния импульса без потери энергии на границах (или одной из границ) слоя, в то время как для магнитоиндукционного фототока поперек слоя⁵ необходима термализация фотоэлектронов на границе.

Эксперимент проводился при температуре 4,2 К на эпитаксиальных слоях n -CaAs толщиной $7 \div 100$ мкм с подвижностью $\mu \approx 3 \cdot 10^4 \div 1,3 \cdot 10^5$ см²/В · с и концентрацией $n \approx 1 \cdot 10^{14} \div 2 \cdot 10^{15}$ см⁻³ при 77 К, выращенных на полуизолирующих подложках. Поляризация света, падающего на образец с омическими контактами, модулировалась между двумя ортогональными состояниями. Конструкция установки описана в⁶. Измерялся фототок j на частоте модуляции поляризации, возникавший при приложении магнитного поля параллельно поверхности. Для исключения влияния фотомагнитного эффекта Кикоина–Носкова использовалась геометрия $j \parallel B$. Измеренная зависимость фототока от угла между векторами e и B хорошо описывалась формулой (1) во всех исследованных образцах.

На рис. 1 показана зависимость фототока от магнитного поля, измеренная в образце 1 толщиной $d = 36$ мкм, $\mu = 3 \cdot 10^4$ см²/В · с для энергий фотонов $\hbar\omega = 1,552$ и 1,571 эВ, что соответствует начальной энергии электронов, рожденных с тяжелой дыркой, $e = 30$ и 47 мэВ. При $e = 47$ мэВ $> \hbar\Omega_{LO} = 37$ мэВ происходит испускание оптического LO -фонона, поэтому в токе доминируют электроны, рожденные с легкой дыркой. Смена знака эффекта обусловлена тем, что направления преимущественного вылета электронов из тяжелого и легкого каналов вза-

имно ортогональны¹.

На рис. 2 показана зависимость $j(B)$ в наиболее интересном случае $\Lambda_p > d$ (образец 2, $d = 12 \text{ мкм}$, $\mu = 8 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, $\Lambda_p = 18 \text{ мкм}$ при $\epsilon = 30 \text{ мэВ}$). Видно, что в области малых полей фототок меняет знак. Мы полагаем, что это обусловлено рассеянием баллистических электронов на границе пленка–подложка, которое создает вклад в ток противоположного знака. Этот вклад преобладает в малых полях, если $\Lambda_p \gg d$ и $P_2 > P_1$. При больших B , когда циклотронный радиус $r_c < d/2$, задняя граница становится недостижимой для баллистических

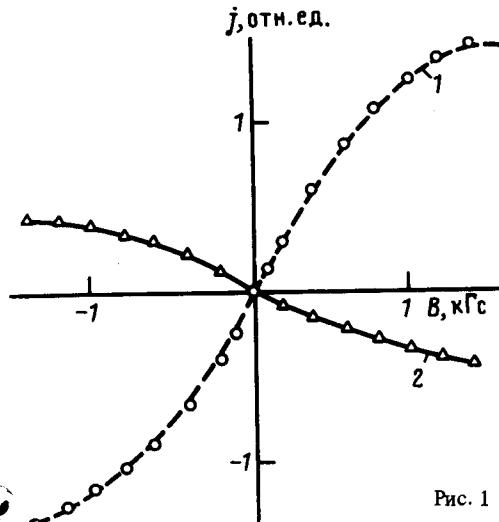


Рис. 1

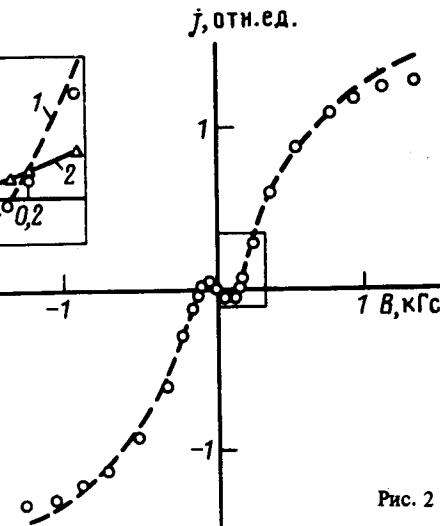


Рис. 2

Рис. 1. Зависимость $j(B)$ в образце 1 при $\hbar\omega = 1,552 \text{ эВ}$ (1) и $1,571 \text{ эВ}$ (2). Сплошная линия проведена через экспериментальные точки, штриховая – расчет ($\Lambda_p = 7 \text{ мкм}$)

Рис. 2. Зависимость $j(B)$ в образце 2 при $\hbar\omega = 1,552 \text{ эВ}$. Штриховая линия – расчет. На вставке показаны зависимости $j(B)$ в области малых B для $\hbar\omega = 1,552 \text{ эВ}$ (1) и $1,540 \text{ эВ}$ (2)

ких фотоэлектронов. При этом остается только вклад от рассеяния на передней границе, возрастающий вплоть до значительно больших полей, соответствующих $r_c \sim \alpha^{-1}$, где $\alpha^{-1} \approx 1 \text{ мкм}$ глубина поглощения света. В случае возбуждения фотоэлектронов с меньшей энергией $\epsilon = 19 \text{ эВ}$ ($\hbar\omega = 1,540 \text{ эВ}$), соответствующее уменьшение длины пробега² ($\Lambda_p = 9 \text{ мкм}$) также приводит к подавлению вклада рассеяния на задней границе (вставка на рис. 2).

Приведенные качественные объяснения были подтверждены численным расчетом фототока в фуксовской модели рассеяния на обеих границах. При этом коэффициенты диффузности P_1 и P_2 были подгоночными параметрами. Величина $\Lambda_p(\epsilon)$ рассчитывалась с учетом рассеяния электронов на заряженных примесях и деформационном потенциале акустических фонаров². Концентрация примесей определялась по подвижности μ . Результаты приведены на рис. 1, 2. Наилучшее совпадение с экспериментом соответствует $P_1 \approx 0,2$ и $P_2 \approx 0,7$ при $\epsilon = 30 \text{ мэВ}$. Качественное соответствие эксперимента расчету (немонотонная зависимость от B при $\Lambda_p \gg d$, насыщение при больших B) наблюдалось во всех исследованных образцах. В некоторых образцах, однако, зависимость $j(B)$ не удавалось количественно описать расчетом. Возможной причиной расхождений является влияние электрического поля, обусловленного рядом поверхности и границы раздела пленка–подложка.

Авторы благодарны Ю.Б.Болховитянову, Н.С.Рудой, В.М.Залетину и А.И.Торопову за предоставление образцов, а также В.И.Белиничеру, З.Д.Квону и М.В.Энтину за полезное обсуждение результатов работы.

Литература

1. Захарченя Б.П. и др. УФН, 1982, 136, 459.
2. Магарилл Л.И., Энтин М.В. ФТТ, 1979, 21, 1280.
3. Альперович В.Л. и др. Письма в ЖЭТФ, 1981, 34, 437.
4. Белиничер В.И., Новиков В.Н. ФТП, 1981, 15, 1957.
5. Альперович В.Л. и др. Письма в ЖЭТФ, 1989, 49, 19.
6. Альперович В.Л. и др. ПТЭ, 1988, № 4, 172.

Институт физики полупроводников
Сибирское отделение Академии наук СССР

Поступила в редакцию
14 апреля 1989 г.